



「楠梓產業園區設置計畫」 里長座談會

110年11月2日

一、計畫緣起及目的



公開會議辦理依據

開發行為環境影響評估作業準則 第 15 條

開發單位作成說明書前，應依下列事項辦理：

- 將說明書主要內容，刊登於指定網站，供民眾、團體及機關於刊登日起二十日內以書面或於指定網站表達意見。
- 舉行公開會議供民眾表達意見。

一、計畫緣起及目的

行政院「美中科技戰下
臺灣半導體前瞻科研及人才布局」

南部半導體材料「S」廊帶

楠梓產業園區
(原高雄煉油廠)為半導體材料研發核心

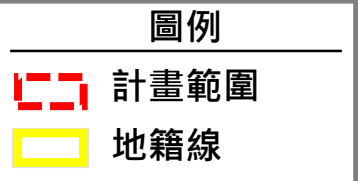
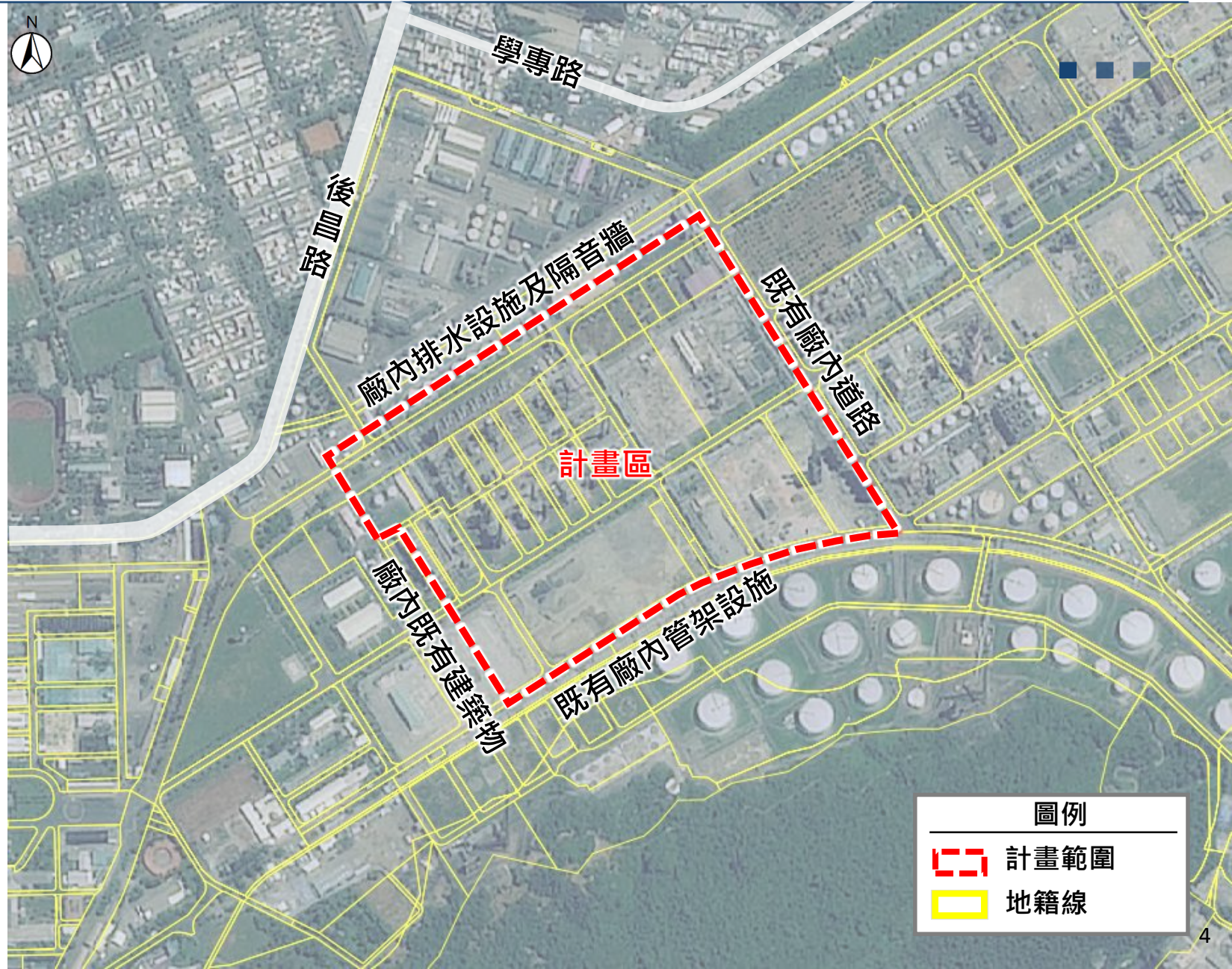
引領高雄市產業
朝高值化發展與深化產業發展根基



二、開發內容概述

計畫範圍

- 範圍：
 - 東界：既有煉油廠內道路
 - 南界：既有煉油廠內管架設施為
 - 西界：煉油廠內既有建築物
 - 北界：煉油廠內排水設施、隔音牆
- 面積：約29.83公頃。



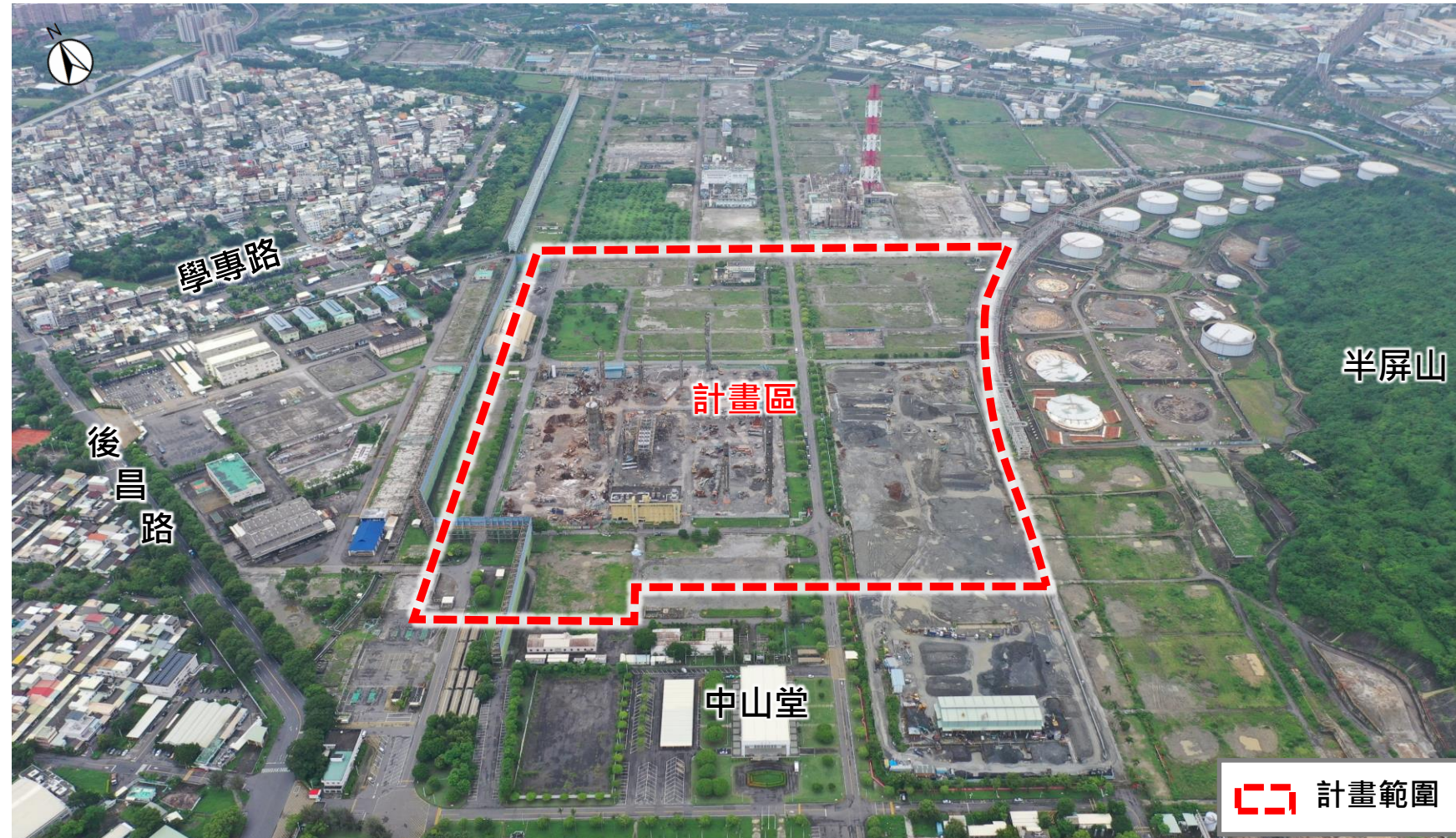
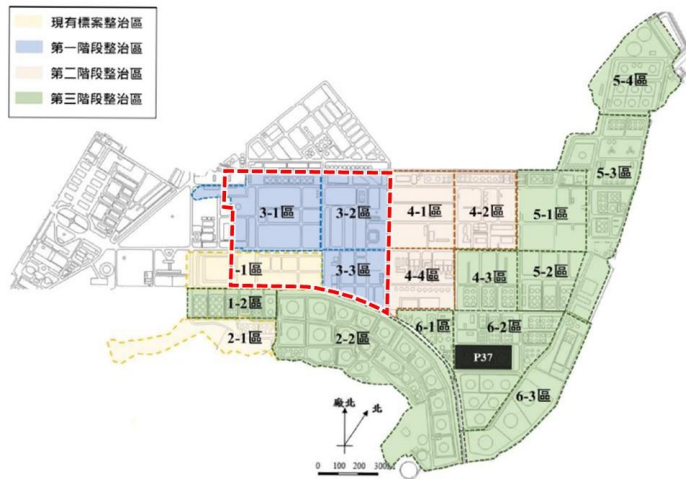
二、開發內容概述

土地使用現況

- 原高煉廠停止營運，設施拆除及土污整治中。

土污整治情形

- 第3區：預計**111年3月**完成土壤整治(解列)。
- 第1-1區：預計今年底完成土壤整治(解列)。



二、開發內容概述

土地權屬概況

- 皆屬台灣中油公司土地

引進產業規劃

- 電子零組件製造業(C26)。
- 電腦、電子產品及光學製品製造業(C27)。
- 其他經目的事業主管機關同意之產業。

聯外交通

- 東側：使用原廠內道路連接高楠公路1003巷至高楠公路
- 西側：使用原廠內道路連接至後昌路或左楠路。



二、開發內容概述

土地使用計畫



土地使用		面積 (公頃)	百分比
土地使用分區	產業專用區	22.80	76.43%
	公園用地(兼供滯洪池使用)	3.61	12.10%
公共設施用地	公園用地(兼供自來水設施使用)	2.89	9.69%
	綠地用地	0.35	1.17%
	道路用地	0.18	0.60%
	小計	7.03	23.57%
	總計	29.83	100.00%

註：土地使用計畫內容應以變更都市計畫公告實施內容為準。

圖例	
	計畫範圍
	產業專用區
	公園用地(兼供滯洪池使用)
	公園用地(兼供自來水設施使用)
	綠地用地
	道路用地

二、開發內容概述

發展願景及開發效益

科技新聚落・楠梓新樞紐

- ◆發展為半導體材料研發核心
- ◆串聯南科、橋科等相關科技產業聚落
- ◆就業人口約1,500人
- ◆推估產值約1,576億元/年

開發期程

- ◆採公共工程與廠商廠房同步施工方式推動
- ◆預計施工工期約1.5年
(實際建設時程將視各主管機關審查狀況、土地取得作業狀況、產業園區土地租售作業及開發狀況等調整)

南科高雄園區
光電、醫材、航太

橋頭科學園區
半導體先進材料、生醫科技、航太

楠梓產業園區
半導體、光學、電子零組件

仁武產業園區
智慧農業、綠能、汽車

屏東科學園區
智慧農業、綠能、汽車

和發產業園區
綜合型產業園區

簡報結束，謝謝指教

